



PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Docket No: Q76787

Takeshi SHIMIZU

Appln. No.: 10/633,716

Group Art Unit: Unknown

Confirmation No.: Unknown

Examiner: Unknown

Filed: August 5, 2003

For: METHOD FOR MEASURING GAP BETWEEN MASK AND SUBSTRATE OF
DISPLAY PANEL

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of Japanese Patent Application No. 2002-227269,
the priority document on which a claim to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The
Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,

SUGHRUE MION, PLLC
Telephone: (202) 293-7060
Facsimile: (202) 293-7860

J. Frank Osha
Registration No. 24,625

WASHINGTON OFFICE

23373

CUSTOMER NUMBER

Enclosure: Japanese Patent Application No. 2002-227269

Date: November 7, 2003

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

T. Shimizu
10/633,716
Filed 11/7/03
Φ 76787 1041

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日
Date of Application:

2002年 8月 5日

出願番号
Application Number:

特願2002-227269

[ST.10/C]:

[JP2002-227269]

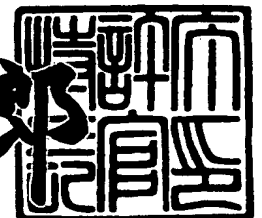
出願人
Applicant(s):

日本電気株式会社

2003年 6月20日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 / 出証特2003-3048618

【書類名】 特許願

【整理番号】 76210356

【提出日】 平成14年 8月 5日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01B 11/00
G03F 7/20

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
日本電気株式会社内

 【氏名】 清水 丈司

【特許出願人】

 【識別番号】 000004237

 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

 【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100096105

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 天野 広

 【電話番号】 03(5484)2241

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 038830

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9715826

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 プラズマディスプレイパネルにおけるマスクと基板との間のギャップの測定方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数のパターンが形成されているガラスマスクと、そのガラスマスクを介して前記パターンを露光する基板との間のギャップを測定する方法であって、

前記複数のパターンのうちの相互に隣接するパターンの間に設けられている非パターン領域を介して前記基板にレーザ光を照射し、前記基板から反射してきたレーザ光に基づいて前記ギャップを測定する方法。

【請求項 2】 前記複数のパターンは直線状に配列されていることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】 前記複数のパターンはマトリクス状に配列されていることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】 複数のパターンが形成されているガラスマスクを介して前記パターンを基板ステージ上の基板に露光する露光方法であって、

前記ガラスマスクを前記基板ステージに平行に隔置した状態に設定する第一の過程と、

前記複数のパターンのうちの相互に隣接するパターンの間に設けられている非パターン領域を介して前記基板にレーザ光を照射し、前記基板から反射してきたレーザ光に基づいて前記ガラスマスクと前記基板との間のギャップを測定する第二の過程と、

前記第二の過程における測定結果に基づいて前記ガラスマスクの反りを矯正する第三の過程と、

を備えることを特徴とする露光方法。

【請求項 5】 前記基板を前記基板ステージに設置する毎に前記ギャップを測定する過程を備えることを特徴とする請求項 4 に記載の露光方法。

【請求項 6】 前記ガラスマスクを交換する毎に前記ギャップを測定する過程を備えることを特徴とする請求項 4 に記載の露光方法。

【請求項 7】 請求項 4 乃至 6 の何れか一項に記載の露光方法を用いることを特徴とするプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、プラズマディスプレイパネルや液晶パネルなどの製造時に実施される露光方法に関し、特に、露光時における露光用マスクと露光対象である基板との間のギャップの測定方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

プラズマディスプレイパネルや液晶パネルなどの製造プロセスには、所定のパターンが予め形成されているマスクを介して基板上にパターンを露光する過程が含まれている。

【0003】

この過程を実施するための露光装置の一例が特開 2 0 0 1 - 1 2 9 0 5 号公報に記載されている。以下、この露光装置について説明する。

【0004】

図 5 は、同公報に記載されている露光装置 5 0 の模式的な縦断面図である。図 6 は、露光装置 5 0 により露光を行う対象である基板 4 の模式的な上面図であり、図 7 は、露光装置 5 0 において用いられるマスク 1 の模式的な上面図であり、図 8 は、露光装置 5 0 における基板ステージ 6、基板 4 及びマスク 1 の配置関係を示す上面図である。

【0005】

図 5 に示すように、露光装置 5 0 は、一辺の長さが L 6 である正方形形状の載置面 6 S を有し、この載置面 6 S 上に配置された基板 4 を真空吸着する基板ステージ 6 を備えている。この基板ステージ 6 は、駆動部 4 3 及び駆動部 4 3 を制御する制御部 4 0 によって、高さや水平度などの姿勢が制御されるようになっている。

【0006】

図6に示すように、基板4は、一辺の長さが L_4 の正方形をなしており、各コーナーの付近には、一辺の長さが L_5 の基板側ギャップ計測用マーク5が設けられている。また、図5に示すように、基板4は載置面6S上に配置される際に、載置面6Sとは反対側の表面において、基板側ギャップ計測用マーク5を除く領域にレジストが塗布されている。基板4は、例えば、ガラス基板からなる。

【0007】

図5に示すように、基板4の上方には、枠形状のマスキステージ3上に支持されたマスク1が配置されている。マスク1は、所定の露光用パターンが形成されている面が基板4に対向するように配置されている。マスク1は、例えば、ガラスマスクからなる。

【0008】

図7に示すように、マスク1は一辺の長さが L_1 の正方形をなしており、各コーナーの付近には、一辺の長さが L_2 の正方形のマスク側ギャップ計測用マーク2が設けられている。

【0009】

図8に示すように、マスク1及び基板4を露光装置50にセッティングする際には、ギャップ計測用マーク2、5の中心が一致するように、マスク1及び基板4が位置決めされる。

【0010】

図5に示すように、露光装置50は、さらに、マスク1の上方において、レーザー発光部7とレーザー受光部8とを備えている。レーザー発光部7は、レーザー発光部7から出射される出射レーザー光9がマスク側ギャップ計測用マーク2及び基板側ギャップ計測用マーク5に対して約45度の角度で入射するように、マスク1の上方に配置されている。また、レーザー受光部8は、出射レーザー光9がマスク側ギャップ計測用マーク2において反射された反射レーザー光10及びマスク側ギャップ計測用マーク2を透過して基板側ギャップ計測用マーク5において反射された反射レーザー光11の双方を受光し得る位置に配置されている。

【0011】

上記のような構造を有する露光装置50は、以下のようにして、マスク1と基

板 4 との間のギャップを計測する。

【 0 0 1 2 】

レーザ発光部 7 から出射された出射レーザ光 9 は約 4 5 度の角度でマスク側ギャップ計測用マーク 2 に入射され、マスク側ギャップ計測用マーク 2 で反射されるとともに、マスク側ギャップ計測用マーク 2 を透過して基板側ギャップ計測用マーク 5 で反射される。

【 0 0 1 3 】

レーザ受光部 8 は、反射レーザ光 1 0、1 1 を受光して、その受光位置に関するデータを制御部 4 0 に出力する。制御部 4 0 はこのデータに基づいてギャップを計算し、このギャップが一定になるように、駆動部 4 3 を介して基板ステージ 6 の姿勢を制御する。

【 0 0 1 4 】

【発明が解決しようとする課題】

近年、プラズマディスプレイパネル（PDP）などの表示ディスプレイにおいては、生産効率の向上の観点から、基板の大型化が進められており、例えば、一辺の長さが 1 m を超える基板（ガラス基板など）が量産されている。このような大型の基板を一括して露光することにより、小さな基板を多数回露光するよりも、大幅に生産効率を上げることができる。

【 0 0 1 5 】

しかしながら、基板が大型化するにつれて、小さい基板では問題にならないマスクの反りが問題になる。

【 0 0 1 6 】

マスクが反っていると、その反りにより、基板とマスクとの間のギャップが一定に保たれない。このため、例えば、ギャップが設計値のギャップよりも大きい箇所では、露光したパターンの幅は設計値よりも大きくなり、逆に、ギャップが設計値のギャップよりも小さい箇所では、露光したパターンの幅は設計値よりも小さくなる。この結果、同一面内において、パターン幅のバラツキが生じることとなる。

【 0 0 1 7 】

本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、大型基板を一括して露光する際に、マスクと基板との間のギャップを一定に維持するために、その前提として、マスクと基板との間のギャップを測定する方法を提供することを目的とする。

【0018】

【課題を解決するための手段】

この目的を達成するため、本発明は、複数個のパターンが形成されているガラスマスクと、そのガラスマスクを介して前記パターンを露光する基板との間のギャップを測定する方法であって、前記複数個のパターンのうちの相互に隣接するパターンの間に設けられている非パターン領域を介して前記基板にレーザ光を照射し、前記基板から反射してきたレーザ光に基づいて前記ギャップを測定する方法を提供する。

【0019】

図5に示した露光装置50を参照すると、基板4を露光する際には、基板4とマスク1との間のギャップは、通常、50乃至250 μ mに設定される。レーザ発光部7とレーザ受光部8とを用いて、基板4とマスク1との間のギャップを測定する場合、出射レーザ光9及び反射レーザ光10、11の通過口としてのマスク側ギャップ計測用マーク2は一辺の長さとして少なくとも2mm程度を必要とする。マスク1のパターンが既に形成されている領域においては、一辺の長さが少なくとも2mm程度のスペースは存在しない。このため、図7に示したように、マスク側ギャップ計測用マーク2はマスク1の外縁付近に形成される。

【0020】

しかしながら、マスク1が大きくなるほど、マスク1の撓みも大きくなり、マスク1の中央部におけるマスク1と基板4との間のギャップは、マスク1の反りの向きに応じて、マスク1の外周におけるマスク1と基板4との間のギャップよりも大きく、あるいは、小さくなる。

【0021】

マスク1の中央部におけるマスク1と基板4との間のギャップは、マスク1の外周におけるマスク1と基板4との間のギャップに基づいて、推定することも可

能であるが、そのためには、推定を行うための演算装置を予め設けておかなければならず、露光装置 5 0 の構造が複雑化する。

【 0 0 2 2 】

これに対して、本発明に係るギャップ測定方法においては、ガラスマスクに形成されている複数のパターンのうちの相互に隣接するパターンの間に設けられている非パターン領域（すなわち、捨て代）を介して基板にレーザ光を照射し、基板から反射してきたレーザ光に基づいてギャップを測定する。

【 0 0 2 3 】

このため、特に、露光装置 5 0 の構造自体には何の変更を加える必要はなく、露光装置 5 0 をそのまま用いて、マスク 1 の中央部におけるマスク 1 と基板 4 との間のギャップを測定することが可能になる。

【 0 0 2 4 】

マスク 1 の中央部におけるマスク 1 と基板 4 との間のギャップが測定されれば、その測定値に基づいて、適当な反り矯正装置を用いてマスク 1 の反りを矯正することができ、ひいては、設計値通りに、マスク 1 上のパターンを基板 4 に露光させることが可能になる。

【 0 0 2 5 】

さらに、本発明は、複数のパターンが形成されているガラスマスクを介して前記パターンを基板ステージ上の基板に露光する露光方法であって、前記ガラスマスクを前記基板ステージに平行に隔置した状態に設定する第一の過程と、前記複数のパターンのうちの相互に隣接するパターンの間に設けられている非パターン領域を介して前記基板にレーザ光を照射し、前記基板から反射してきたレーザ光に基づいて前記ガラスマスクと前記基板との間のギャップを測定する第二の過程と、前記第二の過程における測定結果に基づいて前記ガラスマスクの反りを矯正する第三の過程と、を備えることを特徴とする露光方法を提供する。

【 0 0 2 6 】

例えば、本露光方法は、前記基板を前記基板ステージに設置する毎に前記ギャップを測定する過程、あるいは、前記ガラスマスクを交換する毎に前記ギャップを測定する過程をさらに備えることができる。

【 0 0 2 7 】

上記の露光方法はプラズマディスプレイパネルの製造方法に適用することが可能である。

【 0 0 2 8 】

【発明の実施の形態】

図 1 は、本発明に係るギャップ測定方法において用いる第一の例に係るガラスマスク 5 1 の平面図である。

【 0 0 2 9 】

ガラスマスク 5 1 には、横一列に 2 個の同じ大きさのパターン 5 2、5 3 が形成されている。これらのパターン 5 2、5 3 が図 5 に示した基板 4 上に露光される。

【 0 0 3 0 】

ガラスマスク 5 1 の 4 つのコーナーの付近には、図 7 に示したように、それぞれマスク側ギャップ計測用マーク 2 が形成されており、さらに、パターン 5 2 とパターン 5 3 との間の非パターン領域、すなわち、パターンが形成されていない領域には、マスク側ギャップ計測用マーク 2 a が形成されている。

【 0 0 3 1 】

このマスク側ギャップ計測用マーク 2 a を介してレーザ発光部 7 から基板 4 に出射レーザ光 9 を照射し、さらに、ガラスマスク 5 1 または基板 4 から反射してきた反射レーザ光 1 0、1 1 をレーザ受光部 8 において受光することにより、ガラスマスク 5 1 の中央部におけるガラスマスク 5 1 と基板 4 との間のギャップを測定することができる。

【 0 0 3 2 】

ガラスマスク 5 1 の中央部におけるガラスマスク 5 1 と基板 4 との間のギャップを測定することにより、その測定値に基づいて、ガラスマスク 5 1 の反りを矯正することが可能である。

【 0 0 3 3 】

なお、ガラスマスク 5 1 と基板 4 との間のギャップの測定は、一定周期ごとに行ってもよく、あるいは、任意の時点において行うことも可能である。

【 0 0 3 4 】

例えば、ガラスマスク 5 1 と基板 4 との間のギャップの測定は 1 週間あるいは一カ月毎に行うことができる。例えば、一日当たりの基板 4 の処理枚数が予め定まっているような場合には、一定期間毎にギャップを測定することにより、ギャップを所望の値に維持することができる。

【 0 0 3 5 】

また、一日当たりの基板 4 の処理枚数が一定ではないような場合には、ガラスマスク 5 1 と基板 4 との間のギャップの測定は、基板 4 を基板ステージ 6 (図 5 参照) 上に配置する毎に行ってもよく、あるいは、ガラスマスク 5 1 を交換する毎に行ってもよい。

【 0 0 3 6 】

図 4 に、ガラスマスク 5 1 の反りを矯正するための反り矯正装置の一例を示す。

【 0 0 3 7 】

図 4 に示す反り矯正装置 6 0 は、ガラスマスク 5 1 と同じ大きさを有し、かつ、レーザ発光部 7 が照射するレーザを透過させる透過ガラス 6 1 と、透過ガラス 6 1 とガラスマスク 5 1 とを、相互に平行に隔置した状態で、かつ、透過ガラス 6 1 とガラスマスク 5 1 との間に気密空間 6 3 が形成されるように、保持するマスクホルダー 6 2 と、を備えている。

【 0 0 3 8 】

マスクホルダー 6 2 には、ガス流入口 6 2 a とガス流出口 6 2 b とが形成されている。ガス流入口 6 2 a は高圧空気が充填されているタンク 6 4 に接続されており、ガス流出口 6 2 b は真空ポンプ 6 5 に接続されている。

【 0 0 3 9 】

ガラスマスク 5 1 が基板 4 に向かって凸になるように反っている場合には、真空ポンプ 6 5 を作動させ、気密空間 6 3 の内圧を下げる。これにより、ガラスマスク 5 1 には気密空間 6 3 の方向に向きを有する引っ張り力が作用し、ガラスマスク 5 1 の反りが矯正される。

【 0 0 4 0 】

また、ガラスマスク 5 1 が透過ガラス 6 1 に向かって反っている場合には、タンク 6 4 から高圧空気を気密空間 6 3 の内部に供給する。この結果、ガラスマスク 5 1 には気密空間 6 3 とは逆の方向に向きを有する押圧力が作用し、ガラスマスク 5 1 の反りが矯正される。

【 0 0 4 1 】

ガラスマスク 5 1 の中央部におけるガラスマスク 5 1 と基板 4 との間のギャップが測定されれば、そのギャップに応じて、真空ポンプ 6 5 による気密空間 6 3 の内圧の低下の程度、あるいは、タンク 6 4 から気密空間 6 3 の内部への高圧空気の供給量を調整することにより、ガラスマスク 5 1 の反りを適切に矯正することが可能である。

【 0 0 4 2 】

図 2 は、本発明に係るギャップ測定方法において用いる第二の例に係るガラスマスク 7 1 の平面図である。

【 0 0 4 3 】

ガラスマスク 7 1 には、横一列に 3 個の同じ大きさのパターン 7 2、7 3、7 4 が形成されている。これらのパターン 7 2、7 3、7 4 が図 5 に示した基板 4 上に露光される。

【 0 0 4 4 】

ガラスマスク 7 1 の 4 つのコーナーの付近には、図 7 に示したように、それぞれマスク側ギャップ計測用マーク 2 が形成されており、さらに、パターン 7 2 とパターン 7 3 との間の非パターン領域及びパターン 7 3 とパターン 7 4 との間の非パターン領域にはそれぞれマスク側ギャップ計測用マーク 2 b、2 c が形成されている。

【 0 0 4 5 】

このマスク側ギャップ計測用マーク 2 b、2 c を介してレーザ発光部 7 から基板 4 に出射レーザ光 9 を照射し、さらに、ガラスマスク 7 1 または基板 4 から反射してきた反射レーザ光 1 0、1 1 をレーザ受光部 8 において受光することにより、ガラスマスク 7 1 の全長を L とすれば、 $L/3$ 、 $2L/3$ の位置におけるガラスマスク 7 1 と基板 4 との間のギャップを測定することができる。これらのギ

ギャップの測定値に基づいて、ガラスマスク 7 1 の中央部におけるガラスマスク 7 1 と基板 4 との間のギャップを算出することができる。ガラスマスク 7 1 の中央部におけるガラスマスク 7 1 と基板 4 との間のギャップを算出できれば、前述の第一の例と同様に、図 4 に示した反り矯正装置 6 0 を用いて、ガラスマスク 7 1 の反りを矯正することが可能である。

【 0 0 4 6 】

なお、第一及び第二の例においては、ガラスマスクにそれぞれ 2 個及び 3 個のパターンを形成したものをを用いたが、ガラスマスクに形成されるパターンの数は 2 または 3 に限定されるものではなく、4 以上の任意の数のパターンをガラスマスクに形成することが可能である。

【 0 0 4 7 】

図 3 は、本発明に係るギャップ測定方法において用いる第三の例に係るガラスマスク 8 1 の平面図である。

【 0 0 4 8 】

ガラスマスク 8 1 には、縦横等間隔に、すなわち、マトリクス状に 4 個の同じ大きさのパターン 8 2、8 3、8 4、8 5 が形成されている。これらのパターン 8 2、8 3、8 4、8 5 が図 5 に示した基板 4 上に露光される。

【 0 0 4 9 】

ガラスマスク 8 1 の 4 つのコーナーの付近には、図 7 に示したように、それぞれマスク側ギャップ計測用マーク 2 が形成されており、さらに、パターン 8 2 とパターン 8 3 との間の非パターン領域及びパターン 8 4 とパターン 8 5 との間の非パターン領域にはそれぞれマスク側ギャップ計測用マーク 2 d、2 e が形成されている。また、パターン 8 2 とパターン 8 4 との間の非パターン領域及びパターン 8 3 とパターン 8 5 との間の非パターン領域にはそれぞれマスク側ギャップ計測用マーク 2 f、2 g が形成されている。さらに、ガラスマスク 8 1 の中央にもマスク側ギャップ計測用マーク 2 h が形成されている。

【 0 0 5 0 】

このマスク側ギャップ計測用マーク 2 h を介してレーザ発光部 7 から基板 4 に出射レーザ光 9 を照射し、さらに、ガラスマスク 8 1 または基板 4 から反射して

きた反射レーザ光 10、11 をレーザ受光部 8 において受光することにより、ガラスマスク 81 の中央部におけるガラスマスク 81 と基板 4 との間のギャップを測定することができる。

【0051】

同様に、マスク側ギャップ計測用マーク 2d または 2e を介してレーザ発光部 7 から基板 4 に出射レーザ光 9 を照射し、さらに、ガラスマスク 81 または基板 4 から反射してきた反射レーザ光 10、11 をレーザ受光部 8 において受光することにより、ガラスマスク 81 の中央部におけるガラスマスク 81 と基板 4 との間のギャップを測定することができる。

【0052】

さらには、マスク側ギャップ計測用マーク 2f、2g を介してレーザ発光部 7 から基板 4 に出射レーザ光 9 を照射し、さらに、ガラスマスク 81 または基板 4 から反射してきた反射レーザ光 10、11 をレーザ受光部 8 において受光することにより、ガラスマスク 81 の全長を L とすれば、 $L/4$ 、 $3L/4$ の位置におけるガラスマスク 81 と基板 4 との間のギャップを測定することができる。これらのギャップの測定値に基づいて、ガラスマスク 81 の中央部におけるガラスマスク 81 と基板 4 との間のギャップを算出することも可能である。

【0053】

以上のように、一つまたは複数のマスク側ギャップ計測用マークを用いることにより、ガラスマスク 81 と基板 4 との間のギャップを測定することが可能である。以下に、マスク側ギャップ計測用マークの選択例を挙げる。

- (1) マスク側ギャップ計測用マーク 2h のみ
- (2) マスク側ギャップ計測用マーク 2h、2f、2g
- (3) マスク側ギャップ計測用マーク 2d (または、2e)、2f、2g
- (4) マスク側ギャップ計測用マーク 2f、2g
- (5) マスク側ギャップ計測用マーク 2h、2d (または、2e)、2f、2g
- (6) マスク側ギャップ計測用マーク 2h、2d、2e、2f、2g

ガラスマスク 81 の中央部におけるガラスマスク 81 と基板 4 との間のギャップを算出できれば、前述の第一の例と同様に、図 4 に示した反り矯正装置 60 を

用いて、ガラスマスク 81 の反りを矯正することが可能である。

【0054】

なお、第三の例においては、縦方向に二個、横方向に二個のパターンがそれぞれ形成されているガラスマスクを示したが、縦横両方向に配置できるパターンの数は 2 に限定されるものではなく、3 以上の任意の数のパターンを配置することも可能である。

【0055】

【発明の効果】

以上のように、本発明に係るギャップ測定方法においては、ガラスマスクに形成されている複数個のパターンのうちの相互に隣接するパターンの間に設けられている非パターン領域（すなわち、捨て代）を介して基板にレーザ光を照射し、基板から反射してきたレーザ光に基づいてギャップを測定する。

【0056】

このため、現在使用されている露光装置の構造自体には何の変更を加える必要はなく、その露光装置をそのまま用いて、マスクの中央部におけるマスクと基板との間のギャップを測定することが可能になる。

【0057】

マスクの中央部におけるマスクと基板との間のギャップが測定されれば、その測定値に基づいて、適当な反り矯正装置を用いてマスクの反りを矯正することができ、ひいては、設計値通りに、マスク上のパターンを基板に露光させることが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明に係るギャップ測定方法において用いる第一の例に係るガラスマスクの平面図である。

【図 2】

本発明に係るギャップ測定方法において用いる第二の例に係るガラスマスクの平面図である。

【図 3】

本発明に係るギャップ測定方法において用いる第三の例に係るガラスマスクの平面図である。

【図 4】

ガラスマスクの反りを矯正するための反り矯正装置の一例の断面図である。

【図 5】

一般的な露光装置の模式的な縦断面図である。

【図 6】

図 5 に示した露光装置により露光を行う対象である基板の模式的な上面図である。

【図 7】

図 5 に示した露光装置において用いられるマスクの模式的な上面図である。

【図 8】

図 5 に示した露光装置における基板ステージ、基板及びマスクの配置関係を示す上面図である。

【符号の説明】

5 0 露光装置

1 マスク

2 マスク側ギャップ計測用マーク

4 基板

5 基板側ギャップ計測用マーク

6 基板ステージ

7 レーザ発光部

8 レーザ受光部

5 1 第一の例に係るガラスマスク

5 2、5 3 パターン

6 0 反り矯正装置

6 1 透過ガラス

6 2 マスクホルダー

6 3 気密空間

6 4 タンク

6 5 真空ポンプ

7 1 第二の例に係るガラスマスク

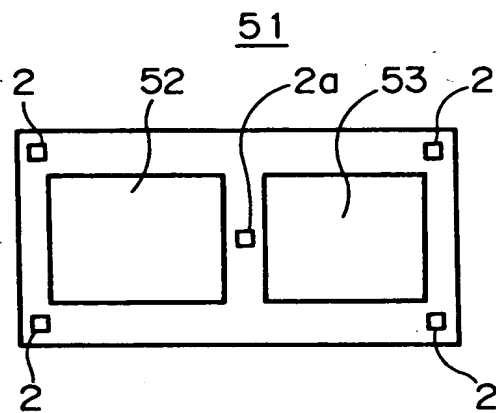
7 2、7 3、7 4 パターン

8 1 第三の例に係るガラスマスク

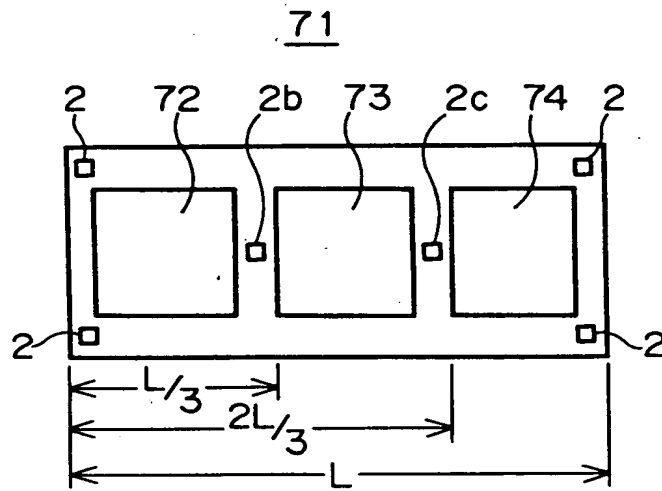
8 2、8 3、8 4、8 5 パターン

【書類名】 図面

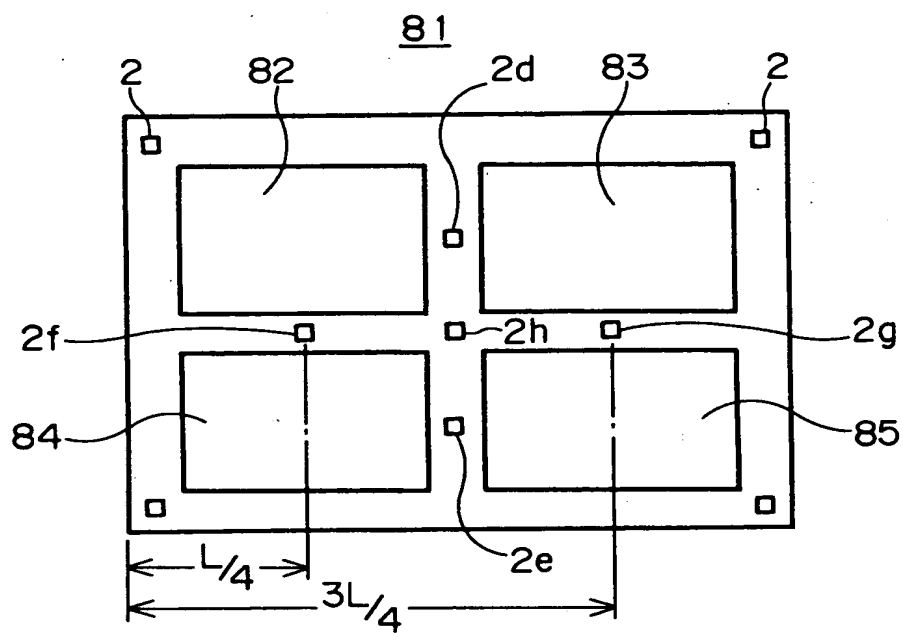
【図 1】



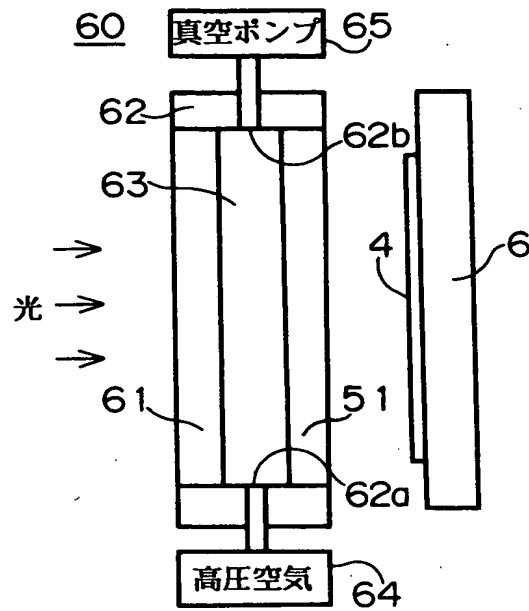
【図 2】



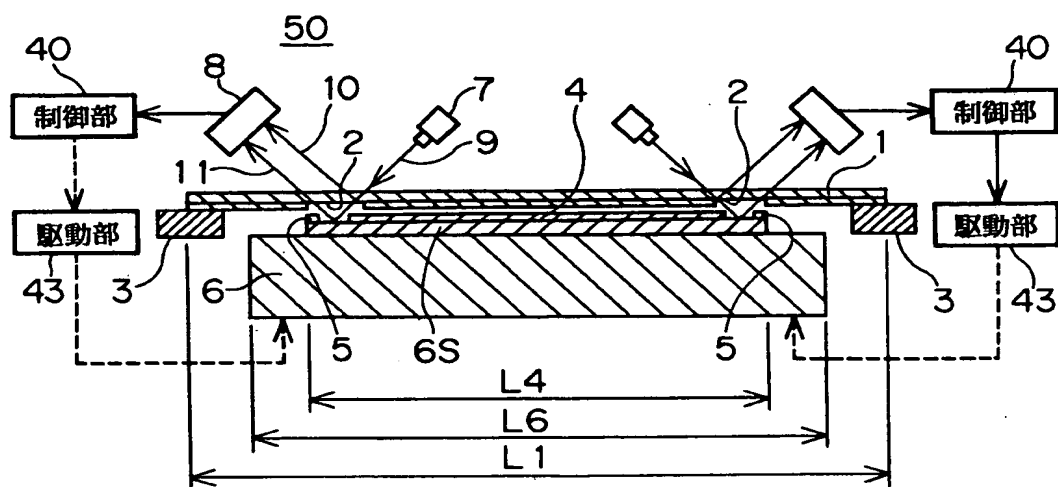
【図 3】



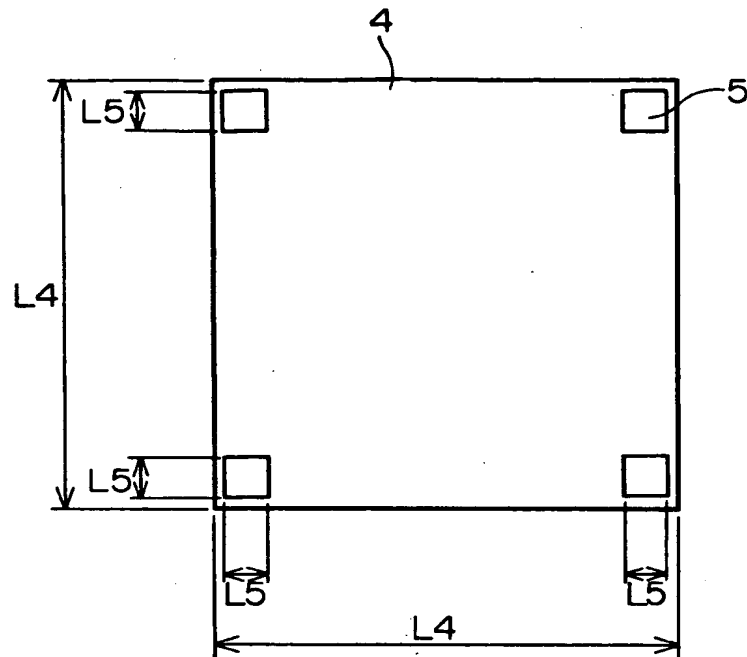
【図 4】



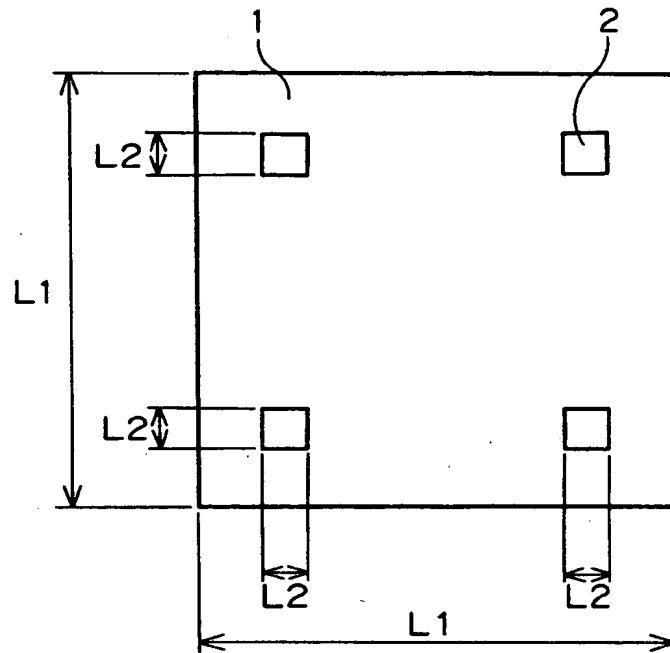
【図 5】



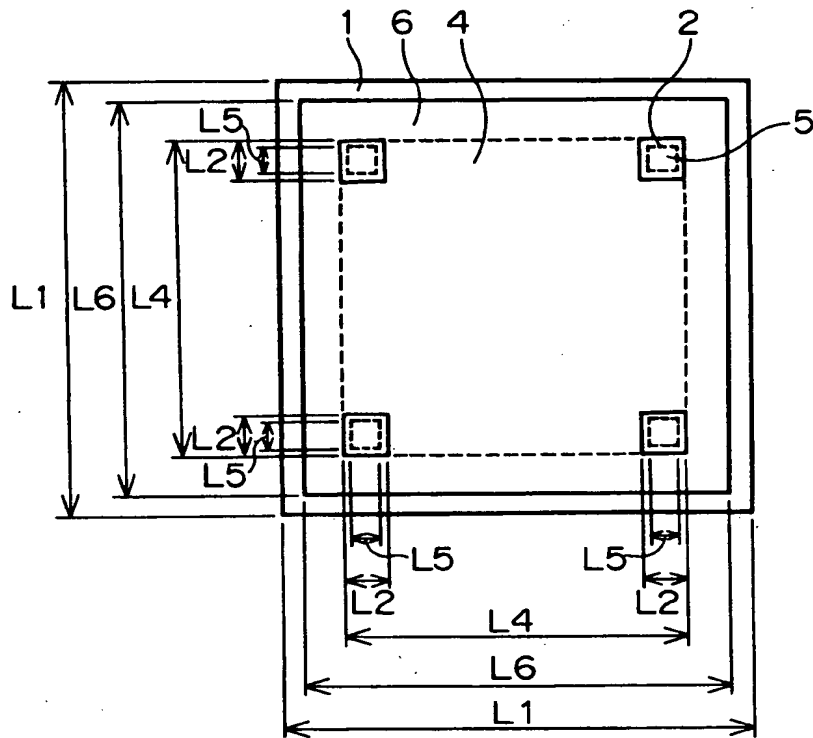
【図 6】



【図 7】



【図 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 プラズマディスプレイパネルの製造プロセスにおいて、大型基板を一括して露光する際に、マスクと基板との間のギャップを測定する。

【解決手段】 複数個のパターン 5 2、5 3 が形成されているガラスマスク 5 1 と、そのガラスマスクを介してパターン 5 2、5 3 を露光する基板との間のギャップを測定する方法であって、相互に隣接するパターン 5 2、5 3 の間に設けられている非パターン領域 2 a を介して基板にレーザ光を照射し、基板から反射してきたレーザ光に基づいて、ギャップを測定する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004237]

1. 変更年月日	1990年 8月29日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都港区芝五丁目7番1号
氏 名	日本電気株式会社